PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-338548

(43) Date of publication of application: 27.11.2002

(51)Int.CI.

C07D231/52 G03C 7/384

(21)Application number: 2001-149314

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22) Date of filing:

18.05.2001

(72)Inventor: SUZUKI AKIRA

YAMAKAWA KAZUYOSHI

(54) METHOD FOR PRODUCING 3 -AMINO-4-SUBSTITUTED-5-PYRAZOLONES (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for producing a 3-amino-4-substituted-5-pyrazolone providing preferable photographic performances, with which a benzoyl group of a 4-substituted-5-pyrazolone containing a benzoylamino group, which may contain a substituent group, at the 3-position is efficiently deprotected, productivity is high and a mass production can be carried out.

SOLUTION: This method for producing a 3-amino-4-substituted-5-pyrazolone is characterized in that the method comprises a process for subjecting the benzoylamino group of the 4-substituted-5-pyrazolone containing a benzoylamino group, which may contain a substituent group, at the 3-position to an alkali hydrolysis.

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-338548 (P2002-338548A)

(43)公開日 平成14年11月27日(2002.11.27)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

C 0 7 D 231/52 G03C 7/384 C 0 7 D 231/52 G 0 3 C 7/384 2H016

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 14 頁)

(21)出願番号

特願2001-149314(P2001-149314)

(71)出願人 000005201

富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中沼210番地

(22)出願日

平成13年5月18日(2001.5.18)

(72)発明者 鈴木 亮

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真

フイルム株式会社内

(72) 発明者 山川 一義

神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真

フイルム株式会社内

(74)代理人 100058479

弁理士 鈴江 武彦 (外5名)

Fターム(参考) 2H016 BF04

(54) 【発明の名称】 3-アミノ-4-置換-5-ピラゾロン類の製造方法

(57)【要約】

【課題】 置換基を有してもよいベンゾイルアミノ基を 3-位に有する4-置換-5-ピラゾロン類のベンゾイ ル基を効率的に脱保護し、生産性が高く、大量製造が可 能で、好ましい写真性を与える3-アミノー4-置換-5-ピラゾロン類の製造方法を提供すること。

【解決手段】 置換基を有してもよいベンゾイルアミノ 基を3-位に有する4-置換-5-ピラゾロン類の該べ ンゾイルアミノ基をアルカリ加水分解する工程を含むこ とを特徴とする3-アミノー4-置換-5-ピラゾロン 類の製造方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 置換基を有してもよいベンゾイルアミノ基を3-位に有する4-置換-5-ピラゾロン類の該ベンゾイルアミノ基をアルカリ加水分解する工程を含むことを特徴とする3-アミノ-4-置換-5-ピラゾロン類の製造方法。

【請求項2】 前記置換基を有してもよいベンゾイルアミノ基を3-位に有する4-置換-5-ピラゾロン類が下記一般式(I)で表されることを特徴とする請求項1に記載の製造方法。

【化1】

$$(R^2)_{\Omega}$$

$$O$$

$$NH$$

$$N$$

$$R^1$$

$$(1)$$

式中、Lはチオシアノ基、アリールオキシ基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ環チオ基、イミド基、イミダゾリル基、ピラゾリル基、または 20トリアゾリル基を表わす。 R^1 は無置換もしくは置換のアルキル基、または無置換もしくは置換のアリール基を表し、 R^2 はベンゼン環上の置換基を表し、nは $0\sim5$ の整数を表す。nが2以上のとき、複数ある R^2 は同じでも異なっていてもよい。

【請求項3】 前記アルカリ加水分解が、バリウム化合物の存在下行なわれることを特徴とする請求項1または2に記載の製造方法。

【請求項4】 前記アルカリ加水分解が、リチウム化合物の存在下行なわれることを特徴とする請求項1または 302に記載の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば写真感光材料用カプラー中間体、カラーマーキング材料中間体として有用な3-アミノ-4-置換-5-ピラゾロン類の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】ピラゾロン残基を有するエチレン型不飽和単量体から誘導される繰り返し単位を有する単独重合体または共重合体であるマゼンタ色像形成2当量カプラーは、減色法カラー写真のマゼンタカプラーとして特に有用である。これは米国特許第4367282号(特開昭58-224352号に対応)明細書などに開示されている。

【0003】このポリマーカプラーの繰り返し単位を与えるピラゾロン残基を有するエチレン型不飽和単量体は、4一位に現像主薬酸化体とのカップリング反応により離脱し得る基(以下、「カップリング離脱基」という。)を導入する工程を含み、3ーアミノー4ー置換ー5ーピラゾロン類の3一位のアミノ基に、エチレン型型でもかできる。ここで中間体である3ーアミノー4ー置換ー5ーピラゾロン類は、従来、下記スキーム1に示さとように、3ーアミノー5ーピラゾロン体(A)を出発に、3ーアミノ基をアセチル基で保護した後、4ーハロゲン体(C)に導き、置換工程で離脱基を導入し、続いてアセチル基を脱保護することで得られていた。

【0004】スキーム1 【化2】

H₂N CH₃CONH X CH₃CONH X R³ (C) (C) (C) (E)

【0005】この方法における鍵反応工程は化合物

(C)から化合物(D)を導く置換工程である。しかしこの工程は非常に収率が低く、また副生成物も多いという問題があった。この問題を解決するために、3-位アミノ基の保護基にベンゾイル基を用いることで、置換工程の収率を大幅に改善できることが報告されている。

(特開昭62-70363号参照) ここでは、該ベンゾイル基の脱保護手段として酸加水分解が用いられてい

る

【0006】しかしながら酸加水分解によるベンゾイル基の脱保護はアセチル基の脱保護に比べて高温長時間を要し、この方法で合成した化合物から合成されるポリマーカプラーを用いて調製した感光材料の写真性が悪化する、という問題があった。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、置換

基を有してもよいベンゾイルアミノ基を3ー位に有する4ー置換ー5ーピラゾロン類のベンゾイル基を効率的に脱保護し、生産性が高く、大量製造が可能で、好ましい写真性を与える3ーアミノー4ー置換ー5ーピラゾロン類の製造方法を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】鋭意検討を重ねた結果、本発明の目的は、下記(1)~(4)により達成された。

【0009】(1) 置換基を有してもよいベンゾイルアミノ基を3-位に有する4-置換-5-ピラゾロン類の該ベンゾイルアミノ基をアルカリ加水分解する工程を含むことを特徴とする3-アミノ-4-置換-5-ピラゾロン類の製造方法。

【0010】(2) 前記置換基を有してもよいベンゾイルアミノ基を3-位に有する4-置換-5-ピラゾロン類が下記一般式(I)で表されることを特徴とする(1)に記載の製造方法。

[0011]

【化3】

$$(R^2)_{\Pi}$$

$$0$$

$$N_{\Pi}$$

$$R^1$$

$$(1)$$

【0012】式中、Lはチオシアノ基、アリールオキシ基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ環チオ基、イミド基、イミダゾリル基、ピラゾリル基、またはトリアゾリル基を表わす。R¹ は無置換もしくは置換のアルキル基、または無置換もしくは置換のアリール基を表し、R² はベンゼン環上の置換基を表し、nは0~5の整数を表す。nが2以上のとき、複数あるR² は同じでも異なっていてもよい。

【0021】R1は無置換もしくは置換アルキル基、または無置換もしくは置換アリール基であり、アルキル基は炭素数1~15のものが好ましく、直鎖状でも分岐鎖状でも環状でもよい。アリール基はフェニル基もしくはナフチル基が好ましく、特にフェニル基が好ましい。アルキル基、アリール基各々の置換基の例としては、ハロゲン原子(例えばフッ素原子、塩素原子)、アルキル基(例えばメチル、エチル)、アリール基(例えばフェニ

【0013】(3) 前記アルカリ加水分解が、バリウム化合物の存在下行なわれることを特徴とする(1)または(2)に記載の製造方法。

【0014】(4) 前記アルカリ加水分解が、リチウム化合物の存在下行なわれることを特徴とする(1)または(2)に記載の製造方法。

[0015]

【発明の実施形態】以下に本発明の製造方法について詳しく説明する。本発明の製造方法は、置換基を有してもよいペンゾイルアミノ基を3-位に有する4-置換-5-ピラゾロン類の該ベンゾイルアミノ基をアルカリ加水分解する工程を含む。

【0016】本発明において、置換基を有してもよいベンゾイルアミノ基を3-位に有する4-置換-5-ピラゾロン類は、3-位のベンゾイルアミノ基のベンゾイル基を保護基として有するものであり、下記一般式(I)で表されるものが好ましい。

[0017]

【化4】

$$(R^2)_{\Pi}$$

$$0$$

$$N_{N}$$

$$R^1$$

$$(1)$$

【0018】式中、Lはカップリング離脱基を表す。R1 は無置換もしくは置換のアルキル基、または無置換もしくは置換のアリール基を表し、 R^2 はベンゼン環上の置換基を表し、R1 はR2 は一次でも異なっていてもよい。

【0019】また一般式(I)は以下に示すように互変 異性体として示すこともできる。

[0020]

【化5】

互変異性体

ル、ナフチル)、シアノ基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基(例えばメトキシカルボニル)、アリールオキシカルボニル基(例えばフェノキシカルボニル)、置換又は無置換のカルバモイル基(例えばカルバモイル、N-フェニルカルバモイル、N, N-ジメチルカルバモイル)、アシル基(例えばアセチル、ベンゾイル)、ニトロ基、置換または無置換のアミノ基(例えばアミノ、ジメチルアミノ、アニリノ)、アシルアミノ基

(例えばアセチルアミノ、ベンゾイルアミノ)、スルホ ンアミド基(例えばメタンスルホンアミド)、イミド基 (例えばスクシンイミド、フタルイミド)、イミノ基 (例えばベンジリデンアミノ)、ヒドロキシ基、アルコ キシ基(例えばメトキシ)、アリールオキシ基(例えば フェノキシ)、アシルオキシ基(例えばアセトキシ)、 アルキルスルホニルオキシ基(例えばメタンスルホニリ オキシ)、アリールスルホニルオキシ基(例えばペンゼ ンスルホニルオキシ)、スルホ基、置換または無置換の スルファモイル基(例えばスルファモイル、N-フェニ ルスルファモイル)、アルキルチオ基(例えばメチルチ オ)、アリールチオ基(例えばフェニルチオ)アルキル スルホニル基(例えばメタンスルホニル)、アリールス ルホニル基 (例えばベンゼンスルホニル) 、ヘテロ環類 などを挙げることができる。また、置換基は更に置換さ れていてもよく、置換基が複数ある場合は、同じでも異 なってもよい。また、置換基は、アルキル基もしくはア リール基と縮合環を形成してもよい。置換基として好ま しくはハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、カルボキシ ル基、アルコキシ基、アルキル基、スルホ基、スルファ モイル基、アリール基、アリールオキシ基、アシルアミ ノ基、スルホンアミド基であり、ハロゲン原子が特に好 ましい。R1として特に好ましいのは塩素原子が1~3 個置換したフェニル基である。

【0022】 R² で表されるベンゼン環上の置換基として好ましくは、例えばハロゲン原子、アルコキシ基、アルキル基、ニトロ基、シアノ基等が挙げられる。より好ましくはハロゲン原子、炭素数1~4のアルキル基または炭素数1~4のアルコキシ基であり、メチル基、塩素

6

原子、メトキシ基が特に好ましい。 n は好ましくは 0 または 1 ないし 2 であり、特に好ましくは 0 または 1 である。

【0023】しで表されるカップリング離脱基の好まし い例は、チオシアノ基、アリールオキシ基(例えばフェ ノキシ、pークロロフェノキシ、pーニトロフェノキ シ)、アルコキシ基、アルキルチオ基(例えば炭素数4 ~10のアルキルチオ)、アリールチオ基(例えばフェ ニルチオ)、ヘテロ環チオ基(例えば2-ベンゾチアゾ リルチオ、1-フェニル-5-テトラブリルチオ、2-ベンズオキサゾリルチオ、)、イミド基(例えば5,5 ージメチルー3ーヒダントイニル)、イミダゾリル基 (例えば1-イミダゾリル、2-メチル-1-イミダゾ リル、1ーベンズイミダゾリル)、ピラゾリル基(例え ば1-ピラゾリル、4-メチル-1-ピラゾリル、3, 5-ジメチルー1ーピラゾリル、4-クロロー1ーピラ ゾリル、4ープロモー1ーピラゾリル)、またはトリア ゾリル基(1-トリアゾリル、3-クロロ-1-トリア ゾリル、5.6-ジメチルー1ーベンゾトリアゾリル、 5-メトキシカルボニル-1-ベンゾトリアゾリル)等 が挙げられ、より好ましくはアリールオキシ基、イミダ ゾリル基、ピラゾリル基およびトリアゾリル基であり、 ピラゾリル基が特に好ましい。

【0024】さらに、本発明で用いられる置換基を有してもよいベンゾイルアミノ基を3-位に有する4-置換-5-ピラゾロン類(一般式(I))の代表例を以下に示すが、これらに限定されるものではない。

[0025]

【化6】

30

例示化合物 1

例示化合物 2

例示化合物3

例示化合物 5

例示化合物 6

[0026]

【化7】

例示化合物 7

例示化合物 8

例示化合物 9

例示化合物 1 0

例示化合物 1 1

例示化合物 1 2

[0027]

【化8】

例示化合物 1 3

例示化合物 1 4

例示化合物 1 5

例示化合物 1 6

[0028]

例示化合物 18

【化9】

例示化合物 19

例示化合物20

例示化合物 2 1

例示化合物 2 2

[0029]

例示化合物 2 4

【化10】

例示化合物 2 5

例示化合物 2 6

16

例示化合物 2 7

例示化合物 2 8

例示化合物29

例示化合物30

[0030]

【化11】

例示化合物 3 1

例示化合物 3.3

例示化合物 3 5

NHCOC₁₅H₃₁

例示化合物 3 2

例示化合物 3 4

例示化合物36

[0031]

【化12】

例示化合物37

例示化合物39

$$C_2H_5O$$
 NH
 S
 N
 N
 O
 H_2C
 H_3CO
 N
 N
 O

例示化合物 4 1

【0032】本発明における置換基を有してもよいベン ゾイルアミノ基を3-位に有する4-置換-5-ピラゾ ロン類は、例えば特開昭62-70363号等に記載の 方法で調製することができる。

【0033】本発明の加水分解工程において使用し得る 反応溶媒としては特に制限はないが、例えばメタノー

例示化合物38

例示化合物40

例示化合物 4 2

ル、エタノール、2 - プロパノール等のアルコール系溶媒、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶媒、N, N-ジメチルアセトアミド、N-メチルピロリジノン等のアミド系溶媒、ジグライム、ジメトキシエタン、1, 4-ジオキサン、1, 3-ジオキソラン、テトラヒドロフラン、アニソールなどのエーテル系溶媒、アセト

ン、メチルエチルケトン、シクロへキサノン等のケトン 系溶媒、ヘキサン、シクロへキサン等のアルカン系溶 媒、酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル系溶媒、ジメ チルスルホキシド、スルホラン、N, Nージメチルイミ ダゾリジノン、アセトニトリル、ピリジン、水等を用い ることができる。また、2種類以上の溶媒を任意の混合 比で併用してもよい。溶媒として好ましくはアルコール 系溶媒、アミド系溶媒、エーテル系溶媒、ジメチルスル ホキシド、スルホラン、ピリジン、水であり、より好 ましくはアルコール系溶媒、エーテル系溶媒、スルホラ ン、水であり、さらに好ましくはアルコール系溶媒、ス ルホラン、水である。

【0034】本発明の加水分解工程における反応温度は 通常20~200℃であり、40~150℃の範囲がよ り好ましい。反応時間は通常0.5~20時間であり、 3~10時間の範囲が好ましい。また反応には特に不活 性な雰囲気は不要だが、アルゴンもしくは窒素等の雰囲 気下で行うことが好ましい。

【0035】本発明の加水分解反応はアルカリ性条件下 行わる。使用できる塩基に特に限定はなく有機塩基でも 無機塩基でもよい。例えばアルカリ金属もしくはアルカ リ土類金属の水酸化物、炭酸塩、炭酸水素塩、リン酸 塩、カルボン酸塩、アルコキシドおよびアミン類(例え ばアンモニア、ジエチルアミン、トリエチルアミン) 等 を用いることができ、2種類以上を併用してもよい。好 ましくはアルカリ金属もしくはアルカリ土類金属の水酸 化物、炭酸塩、アルコキシドであり、具体的には水酸化 ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム、水酸化 マグネシウム、水酸化バリウム、水酸化カルシウム、炭 酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸リチウム、炭酸マグ 30 ネシウム、炭酸バリウム、炭酸カルシウム、ナトリウム メトキシド、ナトリウムエトキシドであり、特に好まし くは水酸化ナトリウム、水酸化リチウム、水酸化バリウ ム、炭酸ナトリウム、炭酸リチウム、炭酸バリウム、炭 酸カルシウム、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエト キシドである。これらは粉体として添加してもよいし、 任意の濃度の溶液(例えば水溶液、アルコール溶液)と して添加してもよい。

【0036】本発明の加水分解工程において使用する塩 基の添加量は、置換基を有してもよいベンゾイルアミノ 40 基を3-位に有する4-置換-5-ピラゾロン類に対し て好ましくは0.5~100倍モル、さらに好ましくは 1~20倍モルである。

【0037】本発明の加水分解反応はバリウム化合物も

しくはリチウム化合物の存在下行うことが特に好ましい。反応に共存させるバリウム化合物の形態に特に制限はなく、通常、バリウム塩として添加でき、有機塩でも無機塩でもよい。バリウム塩としては、例えば酢酸バリウム、炭酸バリウム、塩化バリウム、アッ化バリウム、過なバリウム、適酸バリウム、酸化バリウム、クロラニル酸バリウム等を挙げることができ、これらのバリウム塩は水和物でもよい。好ましくは酢酸バリウム、酸化バリウム、塩化バリウム、水酸化バリウム、酸化バリウム

【0038】本発明の加水分解工程におけるバリウム塩の添加量は、通常、置換基を有してもよいベンゾイルアミノ基を3-位に有する4-置換-5-ピラゾロン類に対して、0.1~10倍モルの範囲であり、0.5~5倍モルがより好ましい。

【0039】本発明の加水分解反応に共存させるリチウム化合物の形態についてもバリウム化合物と同様特に制限はなく、通常リチウム塩として添加でき、有機塩でも無機塩でもよい。リチウム塩としては、例えば炭酸リウム、水酸化リチウム、塩化リチウム、フッ化リチウム、流酸リチウム、臭化リチウム、水素化リチウムホウ素、水悪塩素酸リチウム、硝酸リチウム、亜硝酸リチウム、流酸リチウム、塩は水和物でもよい。好ましくは炭酸リチウム、硫酸リチウム、塩化リチウム、1、臭化リチウムもしくはこれらの水和物である。

【0040】本発明の加水分解工程におけるリチウム塩の添加量は、通常、置換基を有してもよいベンゾイルアミノ基を3-位に有する4-置換-5-ビラゾロン類に対して、0.1~20倍モルの範囲であり、0.5~10倍モルがより好ましい。

[0041]

【実施例】次に実施例にて本発明を更に詳細に説明する。

【0042】<実施例1>例示化合物(1)1.0g (2.23ミリモル)および表1記載の各種の塩基もしくは酸をメタノール3mlと混合し、60℃で攪拌した。5時間後、HPLCにより反応の進行の程度を確認した。

[0043]

【表1】

entry	酸もしくは塩基	添加量 (mmol)	HPLC 面積% (254nm)		備考
			2	1	
1	Lioh. H ₂ o	11, 15	20. 77	77. 56	本発明
2	NaOH	11, 15	10.30	87. 90	本発明
3	кон	11, 15	5. 16	92. 97	本発明
4	CsOH	8. 92	5. 61	93. 81	本発明
5	Ba (OH) ₂ . 8H ₂ O	4. 46	87. 38	4. 86	本発明
6	36%塩酸	14. 50	2.32	95. 88	比較例

【0044】表1から明らかなように、アルカリ加水分解、特にリチウム化合物、バリウム化合物を用いた場合が特に有効であることが明らかになった。

【0045】〈実施例2〉例示化合物(1)2.0g(4.46ミリモル)および水酸化バリウム.8水和物2.81g(8.91ミリモル)をメタノール6m1と混合し、窒素雰囲気下、65℃で6時間攪拌した。湯浴を外し、内温が40℃まで下がったところでシュウ酸.2水和物2.24g(17.77ミリモル)を添加し、40℃で30分攪拌した。反応液を濾過し、沈殿をメタノールで十分洗浄した。濾液を減圧下濃縮した後、酢酸エチル20m1で抽出し、水で十分洗浄した。水層を除去し、有機層に硫酸ナトリウムを適量加え乾燥した後、沈殿を濾別し、減圧下濃縮した。これをシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し、3ーアミノー4ー(1ーピラゾリル)ー1ー(2,4,6ートリクロロフェニル)ー5ーピラゾロンの結晶を得た。収量1.40g、収率91.1%。目的物の構造は1HーNMRで確認した。

【0046】¹ H-NMR (300MHz:溶媒CD Cl3 内部標準:TMS)

δppm

6. 40 (t, 1H)

6.80 (s, 2H)

7. 62 (d. 1H)

7. 02 (a, 1H)

7. 85 (s, 2H)

8. 10 (d, 1H)

10.15 (s, 1H).

【0047】 <実施例3>3-ベンゾイルアミノ-4-ブロモー1-(2,4,6-トリクロロフェニル)-5-ピラゾロン10.0g(21.66ミリモル)、ピラゾール4.43g(65ミリモル) および2,-6-ジーtertーブチルーpークレゾール716mg(3.25ミリモル)をスルホラン10mlと混合し、窒素雰囲

気下、75℃で7時間攪拌した。湯浴を外し、内温が4 0℃まで下がったところで水酸化バリウム. 8水和物1 3. 66g(43. 32ミリモル)、25%(w/v) 水酸化ナトリウム溶液3.8ml(23.82ミリモ ル) およびメタノール10m1を添加し、窒素雰囲気 下、65℃で6時間攪拌した。湯浴を外し、内温が40 ℃まで下がったところでシュウ酸、2水和物11.2g (88. 8ミリモル) およびメタノール10mlを添加 し40℃で30分攪拌した。反応液を濾過し、沈殿をメ タノール30mlで洗浄した。濾液を減圧下濃縮した 後、酢酸エチル20mlを加え、18%塩酸30mlで 2回抽出した。氷冷下、水層に25%(w/v)水酸化 ナトリウム溶液を攪拌しながら添加して p H 4 程度に調 整した。生じた結晶を濾取し、水30mlで洗浄した。 結晶をメタノールから再結晶し、3-アミノ-4-(1 ーピラゾリル) -1-(2, 4, 6-トリクロロフェニ ル) - 5 - ピラゾロンの結晶を得た。収量 5.4 g、収 率72.2%。目的物の構造は1 H-NMRで確認し た。(条件、帰属は実施例2と同じ)

<実施例4>本発明の実施例3の方法で合成した3-アミノー4-(1-ピラゾリル)-1-(2,4,6-トリクロロフェニル)-5-ピラゾロンを原料として、特開昭58-224352号に記載の方法で特開昭58-224352号に記載のポリマーカプラーIIIを合成し、これを用いて、特開昭58-224352号の実施例1に記載の方法で作成した感光材料試料1(本発明)と、特開昭62-70363号の実施例2(b)に記載の方法で合成した3-アミノー4-(1-ピラゾリル)-1-(2,4,6-トリクロロフェニル)-5-ピラゾロンを原料として、特開昭58-224352号記載のポリマーカプラーIIIを合成し、これを用いて、特開昭58-224352号の実施例1に記載の方法で作成した感光材

. 26

料試料2 (比較例) を用いて、特開昭58-22435 2号の実施例1と同様の条件で写真性を評価した。結果 を表2に示す。 【0048】 【表2】

感光材料 試料 No.	カブリ	ガンマ	相対感度	最大発色 濃度	備考 (カプラー中間体 の製造方法に関し)
1	0. 02	1. 80	100	2.02	本発明
2	0.06	1. 78	9 9	2. 00	比較例

【0049】以上の結果より、本発明の方法で合成した 10 原料から合成されたポリマーカプラ―を用いた感光材料は、比較例に対してカブリが低く、好ましい写真性を与えることがわかる。

[0050]

【発明の効果】本発明により、例えば写真感光材料用カプラー中間体、カラーマーキング材料中間体として有用な3-アミノー4ー置換-5-ピラゾロン類を効率よく製造することが可能になった。

20

30

40